## NAR Labs 國家實驗研究院

## 台灣半導體研究中心

文件名稱:設備作業標準<br/>(CF-L02W Leica e-beam 電子東直寫系統)文件編號:Q3-NL04制訂部門:微影光罩組制訂日期:2019-02-15

## 文件制修訂記錄

版本	編製者	生效日期	核定文號	改版/變更說明	修訂頁次
1.0	劉正財	2019-02-20	IS108006	制定新版	

NARLabs 國:	家實驗研究院	DOCUMENT NO.:	TITLE:			
	<b>算體研究中心</b>	Q3-NL04	設備作業標準			
			(CF-L02V	eam 電子束直寫系統)		
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 1/5 頁	

一、目 的:

定義 Leica e-beam 電子束直寫系統操作規範,以確保操作品質。

二、範 圍:

適用於 Leica e-beam 電子束直寫系統。

三、權 責:

1. 組織權責:工程師負責制定及修改規範。

2. 執行人員資格:經過 Leica e-beam 電子東直寫系統考核通過之人員。

四、 名詞定義:

無。

五、 相關文件:

無。

六、 標準作業程序:

1. 檢查機台運轉告示牌是否為運轉中(圖一),並翻閱設備查看機台狀況是否為正常。

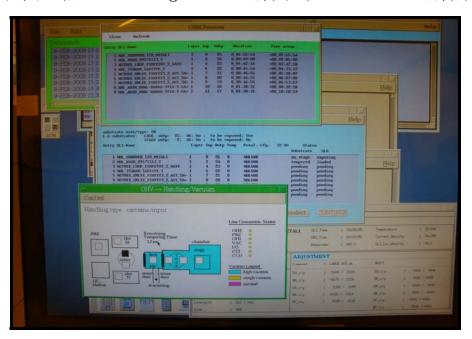


(圖一)

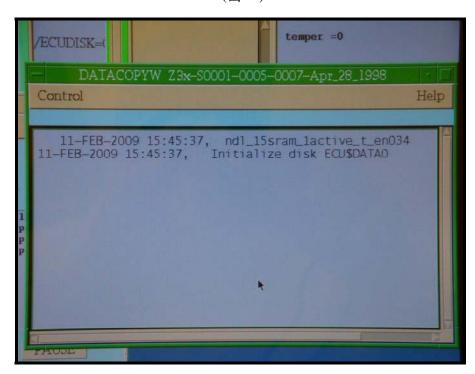
2. 曝光前之確認晶圓確定晶圓沒有破損、彎曲、晶背髒污的情形。

NAR Labs 國	家實驗研究院	DOCUMENT NO.:		TITLE:			
_	<b>算體研究中心</b>	Q3-NL04	設備作業標準				
			(CF-L02W Leica e-b		am 電子束直寫系統)		
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 2/5 頁		

3. 收取晶片前確認無 OHV-handling/Vacuum 視窗(圖二) 及 DATACOPYW 視窗(圖三)。



(圖二)

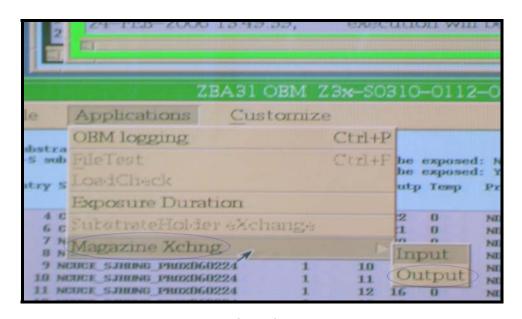


(圖三)

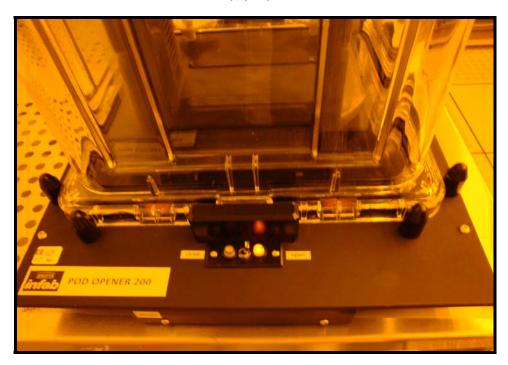
4. OBM 視窗裡顯示 START,表示所有晶片完成曝光,點選 Application 下 → Magazine Xchng → Output(圖四)後,output SIMF box cassette 緩緩升起後停止後,將 SIMF box 取出放置於 POD OPENER 200 台後,開關撥至 OPEN 位置燈亮(圖五),SIMF BOX 盒卸下

NAR Labs 國	家實驗研究院	DOCUMENT NO.:		TITLE:			
_	<b>算體研究中心</b>	Q3-NL04	設備作業標準				
			(CF-L02V	eam 電子束直寫系統)			
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 3/5 頁		

SIMF box cassette 裡晶片收取。晶片收取後,SIMF Box cassette 及 SIMF BOX 盒及放置於 POD OPENER 200台,開關撥至 close 位置燈亮(圖六),SIMF Box 放至 Output Magazine。

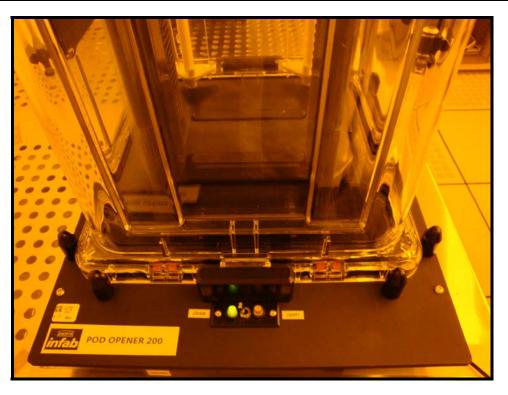


(圖四)



(圖五)

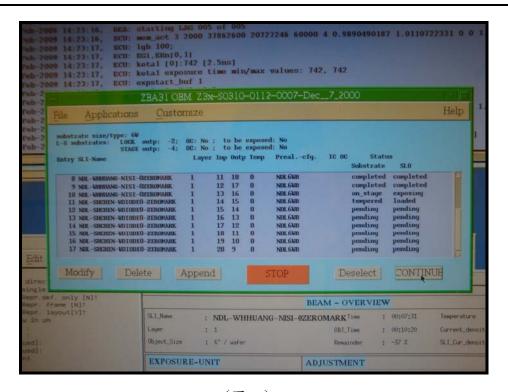
NAR Labs 國	家實驗研究院	DOCUMENT NO.:	TITLE:			
	<b>算體研究中心</b>	Q3-NL04	設備作業標準			
			(CF-L02V	V Leica e-be	am 電子束直寫系統)	
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 4/5 頁	



(圖六)

5. OBM 視窗裡顯示 STOP, 部份晶片完成曝光,檢查 Substrate 及 SLO 下顯示 completed,點選 PAUSE 變成 CONTINUE(圖七) → Application → Magazine Xchng → Output 後 output SIMF box cassette 緩緩升起後停止後,將 SIMF box 放置於拆裝平排台後,開關撥至 OPEN 位置燈亮,SIMF BOX 盒卸下 SIMF box cassette 裡晶片收取。晶片收取後,SIMF Box cassette 及 SIMF BOX 盒及放置於拆裝平排台,開關撥至 close 位置燈亮,SIMF Box 放至 Output Magazine。點選 CONTINUE 變成 PAUSE。

NAR Labs 國	家實驗研究院	DOCUMENT NO.:		TITLE:			
	<b>算體研究中心</b>	Q3-NL04	設備作業標準				
			(CF-L02V	V Leica e-be	am 電子束直寫系統)		
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 5/5 頁		



(圖七)

6. 操作機台時若發生異常狀況,應立即通知負責工程師處理,如為下班時間,請留言在語音信箱中,並將過程詳實登記於設備使用紀錄表與異常及矯正預防處理單中。

## 七、 應用表單及附件:

- 1. Q4-NL02 設備管理卡
- 2. Q4-NL03 設備考核表
- 3. Q4-NL04 設備點檢表
- 4. Q4-NL06 異常及矯正預防處理單